## フラクタル構造を有する Mg/MgO/MgB2/Mg2Si ナノ複合体の合成と その超伝導特性

Synthesis of Mg/MgO/MgB<sub>2</sub>/Mg<sub>2</sub>Si nanocomposites with fractal structure and their superconducting properties

神戸大<sup>1</sup>, 大阪公立大<sup>2</sup> <sup>O</sup>(M2)橋本 碧維<sup>1</sup>, 櫻井 敬博<sup>1</sup>, 太田 仁<sup>1</sup>, 瀬戸 雄介<sup>2</sup>, 内野 隆司<sup>1</sup> Kobe Univ.<sup>1</sup>, Osaka Metropolitan Univ.<sup>2</sup>,

<sup>o</sup>Aoi Hashimoto<sup>1</sup>, Takahiro Sakurai<sup>1</sup>, Hitoshi Ohta<sup>1</sup>, Yusuke Seto<sup>2</sup>, Takashi Uchino<sup>1</sup>

E-mail: 216s215s@stu.kobe-u.ac.jp

【緒言】2 種類以上の材料を組み合わせること により作製される複合材料は、単独の材料では 持ち得ない性質の発現が期待される。超伝導体-半導体複合体は、次世代のスピントロニクス・ フォトエレクトロニクスデバイスの基幹材料と して有望視されているだけでなく、新しいスピ ン秩序発現の場としても注目を集めている[1]。 そこで本研究では、近年我々の研究グループが 見出した Mg/MgO/MgB2 超伝導ナノ複合体[2]の 出発原料として Si 元素を加えて半導体 Mg2Si を 導入することで,超伝導体-半導体ナノ複合体の 合成及び超伝導特性の探索を試みた。この Mg/MgO/MgB<sub>2</sub>ナノ複合体は Mg(金属), MgO (絶縁体), MgB2(超伝導体)がクリーンな界面 を保ちながらフラクタル的に混合した構造を持 つ。この特異な微細構造が超伝導近接効果を階 層的に引き起こすために, 超伝導体である

 $MgB_2$ が希薄(約16 vol%)であっても約39Kで 系全体としてバルク的な超伝導特性を示すとい う特性を有する[2]。本研究では、この  $Mg/MgO/MgB_2$ ナノ複合体への半導体 $Mg_2Si$ の 導入の効果を構造、超伝導特性の観点から調べ ることを目的とした。

【実験】Mg/B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 混合粉末に対して,Si 源として SiO 粉末を 5Mg + B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + xSiO ( $x = 0 \sim 0.22$ )の 組成比となるようになるように加え,Ar 雰囲気 下,700 °C,6 時間で加熱することにより粉末状 の超伝導体-半導体ナノ複合体を合成した。得ら れた粉末試料に対してさらに真空中,700 °C ~ 1100 °C ° SPS 焼結を行い,緻密なバルク状の超 伝導体-半導体ナノ複合体を作製した。これらの 試料に対して X 線粉末回折 (XRD)測定,磁化 測定を行った。

【結果と考察】バルク体試料の XRD 測定及びリ



Figure 1. XRD patterns and the results of quantitative Rietveld analysis of the SPS-treated samples sintered at (a) 700 °C (x = 0.00, 0.04) and (b) 1100 °C (x = 0.00, 0.02). Inset shows a magnified view near  $2\theta = 40^{\circ}$ .



Figure 2. (a) ZFC  $4\pi M/H-T$  (H = 10 Oe) curves and (b) M-H hysteresis (T = 2 K) of the SPS-treated samples for x = 0.00 and 0.04 sintered at 700 °C.



Figure 3. (a) ZFC  $4\pi M/H-T$  (H = 10 Oe) curves and (b) M-H hysteresis (T = 2 K) of the SPS-treated samples for x = 0.00 and 0.02 sintered at 1100 °C.

ートベルト解析の結果(Figure 1)より,全ての試料で MgB2の生成,さらに SiO 添加試料では Mg2Si の生成が確認 された。700 ℃焼結試料の H = 10 Oe におけるゼロ磁場冷却(ZFC)磁化 M の温度 T 依存性(M-T)(Figure 2(a)) より,SiO 添加試料ではバルク的な完全反磁性がより高温でかつ狭い転移幅で達成されることがわかった。T=2 K における磁化 M の外部磁場 H 依存性(M-H)(Figure 2(b))より,SiO 添加試料では磁束ピンニング力の増大が見ら れた。焼結温度を 700 ℃から 1100 ℃に上昇させると,SiO 添加・非添加試料のいずれも顕著な転移幅の減少が観察 された(Figure 3(a))。また M-H ヒステリシス(Figure 3(b))より,1100 ℃焼結試料においても SiO 添加による磁束 ピンニング力の増大が見られた。これらの結果は,Mg2Si が Mg/MgO/MgB2 ナノ複合体の超伝導近接効果による位 相整合状態を壊すことなく磁場排斥効果及び磁束ピンニング力を増強させる効果があることを示唆している。

[1] I. Suemune et al., Appl. Phys. Express 3, 054001 (2010).

[2] T. Uchino, N. Teramachi, et al., Phys. Rev. B 101, 035146 (2020).